

①9



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENÖSSISCHES INSTITUT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

①1 CH 691 307 A5

⑤1 Int. Cl.⁷: C 23 C 014/24

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

①2 PATENTSCHRIFT A5

②1 Gesuchsnummer: 01199/96

②2 Anmeldungsdatum: 10.05.1996

②4 Patent erteilt: 29.06.2001

④5 Patentschrift
veröffentlicht: 29.06.2001

⑦3 Inhaber:
Satis Vacuum Industries Vertriebs AG,
Kohlrainstrasse 1, 8700 Küsnacht ZH (CH)

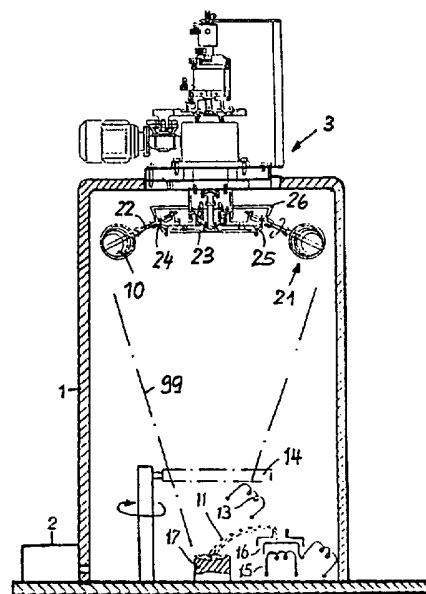
⑦2 Erfinder:
Rudolf Suter, Stegenstrasse 22,
6048 Horw (CH)

⑦4 Vertreter:
Patentanwaltsbüro G. Petschner,
Wannenstrasse 16, 8800 Thalwil (CH)

⑤4 Verfahren zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate.

⑤7 Beim Verfahren zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf Flächen optischer Substrate (10), wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf Trägermittel aufspannbar sind, die sich in einem evakuierbaren Rezipienten (1) oberhalb oder unterhalb von auswechselbaren Verdampfungsquellen (100) befinden, wird jeweils innerhalb eines Bedampfungsvorganges zur Erzeugung einer Vergütungsschicht zunächst die der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der auf Trägermittel (21) aufgespannten Substrate bedampft und dann, ohne Stillsetzung der Verdampfungsquelle, die Trägermittel mit den Substraten rasch gewendet und die nun der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der Substrate ebenfalls bedampft werden, wonach ein zyklisches Auswechseln von Verdampfungsquellen erfolgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Vergütungsschicht auf die Substratflächen innerhalb eines neuen Bedampfungsvorganges.

Durch diese Massnahmen wird nun das zyklische Auswechseln der Verdampfungsquellen um die Hälfte reduziert und damit auch deren Aufheizung, was wiederum die Gefahr einer Zersetzung der Aufdampfmaterialien sowie der Suboxyd-Bildung und der daraus resultierenden Brechwert-Änderungen wesentlich verringert.



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf Flächen optischer Substrate, wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf Trägermittel aufspannbar sind, die sich in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb oder unterhalb von auswechselbaren Verdampfungsquellen befinden.

Bei allen solchen bekannten Verfahren zum Aufdampfen von mindestens einer Oberflächenschicht auf optische Substrate, insbesondere Brillengläser, im Vakuum, werden eine vorgegebene Anzahl solcher Substrate nach dem Aufdampfen von in der Regel mehreren Schichten aus der Ebene, in welcher die Substratflächen der Wirkung der auswechselbaren Verdampfungsquellen ausgesetzt waren, einzeln oder gruppenweise herausbewegt und nochmals eine gleiche Anzahl Substratflächen in diese Ebene hineinbewegt, um diese ebenfalls nachfolgend einmal oder mehrmals zu bedampfen, m.a.W. werden zunächst auf den Substratflächen der einen Seite der Substrate die einzelnen Vergütungsschichten nacheinander aufgedampft, dann die Substrate gewendet und dann die anderen Substratflächen bedampft.

Solche Verfahren sind aber sehr aufwändig, da nach jedem Bedampfungsvorgang die Verdampfungsquelle abgeschaltet und, nach Abkühlung, für eine neue Vergütungsschicht eine neue Quelle eingesetzt werden muss. Dies wiederholt sich dann alles nochmals bei der Beschichtung der Flächen der dann gewendeten Substrate.

Zudem besteht durch das vielmalige Aufheizen der Verdampfungsquellen, welche beispielsweise Elektronenstrahl-Verdampfer oder widerstandsbeheizte thermische Verdampfer sein können, die Gefahr einer Zersetzung der Aufdampfmateriale sowie der Suboxyd-Bildung und der daraus resultierenden Brechwert-Änderungen.

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren der vorgenannten Art zu schaffen, bei dem die vorgenannten Nachteile vermieden werden.

Dies wird beim Verfahren zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf Flächen optischer Substrate, wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf Trägermittel aufspannbar sind, die sich in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb oder unterhalb von auswechselbaren Verdampfungsquellen befinden, erfindungsgemäss dadurch erreicht, dass jeweils innerhalb eines Bedampfungsvorganges zur Erzeugung einer Vergütungsschicht zunächst die der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der auf Trägermittel aufgespannten Substrate bedampft und dann, ohne Stillsetzung der Verdampfungsquelle, die Trägermittel mit den Substraten rasch gewendet und die nun der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der Substrate ebenfalls bedampft werden, wonach ein zyklisches Auswechseln von Verdampfungsquellen erfolgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Vergütungsschicht auf die Substratflächen innerhalb eines neuen Bedampfungsvorganges.

Durch diese Massnahmen wird nun das zyklische Auswechseln der Verdampfungsquellen um die

Hälfte reduziert und damit auch deren Aufheizung, was wiederum die Gefahr einer Zersetzung der Aufdampfmateriale sowie der Suboxyd-Bildung und der daraus resultierenden Brechwert-Änderungen wesentlich verringert.

Vorzugsweise werden alle Substrate gleichzeitig und ohne Unterbrechung des Aufdampfstromes gewendet.

Bei träge wendenden Substraten hingegen, beispielsweise auf kalottenförmigen Wendeträgern, wird während der Wendezeit der Bedampfungsstrahl temporär auf eine einschwenkbare Blende gerichtet und damit die wendenden Trägermittel mit den Substraten gegen den Aufdampfstrom abgedeckt.

Das erfindungsgemässe Verfahren ist nachfolgend anhand von beispielsweise Ausführungsformen einer Vakuum-Beschichtungsanlage anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 im Längsschnitt in schematischer, vereinfachter Darstellung eine Vakuum-Beschichtungsanlage zum Bedampfen mehrerer optischer Substrate auf einer Wendeträger-Vorrichtung; und

Fig. 2 eine Ausführungsvariante der Anordnung gemäss Fig. 1.

Die in Fig. 1 beispielsweise veranschaulichte Vakuum-Beschichtungsanlage zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf optische Substrate, beispielsweise hier Kunststoff-Brillengläser 10, umfasst einen, über eine Vakuum-Pumpe 2 evakuierbaren Rezipienten 1.

Im oberen Kammerbereich dieses Rezipienten 1 befindet sich eine Wendeträger-Vorrichtung 3 mit einer Mehrzahl, hier zwei erkennbare radial um eine kreisförmige Trägerplatte 23 angeordnete Wendeträger 21, die je an einer, temporär um 180° verdrehbaren Drehachse 22 abgestützt sind, wobei jeder Wendeträger 21 Mittel zum klemmenden Festhalten eines beidseitig zu beschichtenden Substrates oder zum Festhalten von zwei einseitig zu beschichtenden Substraten umfasst (nicht gezeigt).

Im unteren Bereich des Rezipienten 1 ist eine Verdampfungsquelle 100 angedeutet, die hier eine sogenannte Elektronenstrahlkanone mit einem Heizfaden 15 umfasst, dessen austretende Elektronen nach seiner Erhitzung in einer Fokussierungseinrichtung 16 strahlenförmig gebündelt werden. Beispielsweise kann der Elektronenstrahl von einer an negativer Hochspannung liegenden Wolframkathode erzeugt und mit einem geformten Wehnelt-Zylinder vorfokussiert werden. Dieser Elektronenstrahl lässt sich nun durch Umlenkmagnetmittel 13 in einen Tiegel 17 umlenken, in dem sich das Aufdampfmaterial befindet.

Zum Betreiben bzw. Bedienen der im evakuierten Rezipienten 1 zu bewegendes Apparateile, wie etwa eine Blende 14 u.dgl., sind Einrichtungen mit Betätigungsbauteilen notwendig, die von aussen in den Vakuumraum hineinreichen (nicht gezeigt). Da der Aufbau und die Funktionsweise solcher Vakuumaufdampfanlagen weiters soweit bekannt sind, erübrigt sich eine nähere Konstruktionsbeschreibung.

Wesentlich ist hier zunächst, dass an den Wendeträgern 21 resp. Drehachsen 22 Wendemittel zum gleichzeitigen Wenden aller Wendeträger angreifen. Hierfür umfassen die Wendemittel einen von der Trägerplatte 23 umfänglich abragenden Zahnkranz 25, in den je ein Mitnahmezahnrad 24 eingreift, das mit der Drehachse 22 der Wendeträger 21 sowie mit einem weiteren, temporär verdrehbaren Gegenzahnkranz 26 in Wirkungsverbindung steht.

Damit ist es möglich, zu geeigneter Zeit den Gegenzahnkranz 26 relativ zum Zahnkranz 25 soweit zu verdrehen, bis die Wendeträger 21 mit ihren Substraten über das jeweilige Mitnahmezahnrad 24 um 180° gedreht sind. Dies erfolgt in Bruchteilen einer Sekunde, also so schnell, dass der Bedampfungsstrahl 99 nicht unterbrochen werden muss.

Eine solche Einrichtung gestattet, dass erfindungsgemäss jeweils innerhalb eines Bedampfungsvorganges zur Erzeugung einer Vergütungsschicht zunächst die der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der auf Trägermittel aufgespannten Substrate bedampft und dann, ohne Stillsetzung der Verdampfungsquelle, die Trägermittel mit den Substraten rasch gewendet und die nun der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der Substrate ebenfalls bedampft werden, wonach ein zyklisches Auswechseln von Verdampfungsquellen erfolgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Vergütungsschicht auf die Substratflächen innerhalb eines neuen Bedampfungsvorganges.

Durch diese Massnahmen wird nun das zyklische Auswechseln der Verdampfungsquellen um die Hälfte reduziert und damit auch deren Aufheizung, was wiederum die Gefahr einer Zersetzung der Aufdampfmaterialien sowie der Suboxyd-Bildung und der daraus resultierenden Brechwert-Änderungen wesentlich verringert.

Vorzugsweise werden alle Substrate gleichzeitig und ohne Unterbrechung des Aufdampfstromes 99 gewendet. Bei träge wendenden Substraten hingegen, beispielsweise auf kalottenförmigen Wendeträgern gemäss Fig. 2, wird während der Wendezeit der Kalotten 33 mit den Substraten 10 mittels Wendevorrichtung 19 der Bedampfungsstrahl temporär auf eine einschwenkbare Blende 14 gerichtet und damit die wendenden Trägermittel mit den Substraten gegen den Aufdampfstrom 99 abgedeckt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Aufdampfen von Vergütungsschichten auf Flächen optischer Substrate, wie Kunststoff-Brillengläser, welche auf Trägermittel aufspannbar sind, die sich in einem evakuierbaren Rezipienten oberhalb oder unterhalb von auswechselbaren Verdampfungsquellen befinden, dadurch gekennzeichnet, dass jeweils innerhalb eines Bedampfungsvorganges zur Erzeugung einer Vergütungsschicht zunächst die der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der auf Trägermittel aufgespannten Substrate bedampft und dann, ohne Stillsetzung der Verdampfungsquelle, die Trägermittel mit den Substraten rasch gewendet und die nun der Verdampfungsquelle zugewendeten Flächen der

Substrate ebenfalls bedampft werden, wonach ein zyklisches Auswechseln von Verdampfungsquellen erfolgt zum Aufbringen jeweils einer weiteren Vergütungsschicht auf die Substratflächen innerhalb eines neuen Bedampfungsvorganges.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass alle Substrate gleichzeitig und ohne Unterbrechung des Aufdampfstromes gewendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass während der Wendezeit der Bedampfungsstrahl temporär auf eine einschwenkbare Blende gerichtet wird und damit die wendenden Trägermittel mit den Substraten gegen den Aufdampfstrom abgedeckt werden.

